

日本磁気科学会 第3回 高分子・材料プロセス分科会

「磁場を利用した材料開発の最前線」

日 時： 2010年5月25日(火)午後1時～5時

場 所： キャンパス・イノベーションセンター 2階 多目的室B
東京都港区芝浦3-3-6
(JR田町駅(芝浦口)より徒歩1分、地下鉄三田駅より徒歩5分)
<http://www.yamagata-u.ac.jp/satellite/html/access.html>

参加費： 1,000円(テキスト代)(学生：無料)

定 員： 50名

参加申込：2010年5月20日(木)までに、下記の連絡先にメールでお申し込み下さい。

連絡先： 山形大学大学院理工学研究科 米竹研究室 佐藤 武志
〒992-8510 山形県米沢市城南4-3-16
TEL:0238-26-3047 E-mail: tac02021@st.yamagata-u.ac.jp

プログラム

12:00～ 受付

12:55～ 開会

13:00～13:40

強磁場による高分子材料の高機能化

ポリマテック株式会社

木村 亨

13:40～14:20

液晶磁場電解重合

筑波大学 大学院

後藤 博正

14:20～14:30 休憩

14:30～15:20 特別講演

磁場によるモノドメイン液晶配向制御とその利用

東京工業大学 大学院

渡辺 順次

15:20～16:00

材料製造プロセス用超電導マグネット ー半導体を中心としてー

ジャパンスーパ-コンダクタテクノロジー株式会社 広瀬 量一

16:00～16:40

添加剤の配向制御による高分子フィルムの特性制御

首都大学東京 大学院

山登 正文